

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 3 部門第 3 区分
【発行日】 平成 17 年 4 月 7 日 (2005.4.7)

【公表番号】 特表 2000-516974(P2000-516974A)

【公表日】 平成 12 年 12 月 19 日 (2000.12.19)

【出願番号】 特願 平 10-510877

【国際特許分類第 7 版】

C 0 8 L 67/02

B 6 5 D 81/24

// B 6 5 D 1/09

(C 0 8 L 67/02

C 0 8 L 77:00)

【F I】

C 0 8 L 67/02

B 6 5 D 81/24 Z

B 6 5 D 1/00 A

C 0 8 L 67/02

C 0 8 L 77:00

【手続補正書】

【提出日】 平成 16 年 7 月 30 日 (2004.7.30)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 補正の内容のとおり

【補正方法】 変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成16年7月³⁰日

特許庁長官 小 川 洋 殿

1. 事件の表示

平成10年特許願第510877号

2. 補正をする者

名称 イーストマン ケミカル カンパニー



3. 代 理 人

住所 〒105-8423 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル

青和特許法律事務所 電話 03-5470-1900

氏名 弁理士(7751) 石 田 敬



4. 補正対象書類名

請求の範囲

5. 補正対象項目名

請求の範囲

6. 補正の内容

請求の範囲を別紙のとおり補正する。

7. 添付書類の目録

請求の範囲

1 通



請求の範囲

1. 少なくとも85モル%のテレフタル酸、2, 6-ナフタレンジカルボン酸またはそれらの混合物からなるジカルボン酸成分、及び少なくとも85モル%のエチレングリコールからの反復単位を含むポリエステル、ならびに融点が該ポリエステルの融点より低い、0.05重量%～2重量%の少なくとも1種のポリアミドからなる容器を用意し、そして

該容器にオゾン処理水を充填する工程

を含んでなる、オゾン処理液体中における不所望な副生成物の形成を最小にする方法。

2. ジカルボン酸成分が炭素数8～14の芳香族ジカルボン酸、炭素数4～12の脂肪族ジカルボン酸、炭素数8～12の脂環式ジカルボン酸及びそれらの混合物からなる群から選ばれた少なくとも1種の第2のジカルボン酸15モル%以下を更に含む請求の範囲第1項に記載の方法。

3. 前記の第2のジカルボン酸が、フタル酸、イソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸、シクロヘキサンジカルボン酸、シクロヘキサン二酢酸、ジフェニルー4, 4'-ジカルボン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、アゼライン酸、セバシン酸及びそれらの混合物からなる群から選ばれる請求の範囲第2項に記載の方法。

4. 前記ポリエステルが15モル%以下の少なくとも1種の追加のジオールをさらに含む請求の範囲第1項に記載の方法。

5. 前記の追加のジオールが、炭素数6～20の脂環式ジオール及び炭素数3～20の脂肪族ジオールからなる群から選ばれる請求の範囲第4項に記載の方法。

6. 前記追加のジオールが、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、1, 4-シクロヘキサンジメタノール、プロパン-1, 3-ジオール、ブタン-1, 2-ジオール、ペンタン-1, 5-ジオール、ヘキサン-1, 6-ジオール、3-メチルペンタンジオール- (2, 4)、2-メチルペンタンジオール- (1, 4)、2, 2, 4-トリメチルペンタンジオール- (1, 3)、2-エチルヘキサジオール- (1, 3)、2, 2-ジエチルプロパンジオール (1, 3)、ヘキサジオール- (1, 3)、1, 4-ジ- (ヒドロキシエトキシ)

ーベンゼン、2, 2-ビス- (4-ヒドロキシ-シクロヘキシル) -プロパン、2, 4-ジヒドロキシ-1, 1, 3, 3-テトラメチル-シクロブタン、2, 2-ビス- (3-ヒドロキシエトキシフェニル) -プロパン、2, 2-ビス- (4-ヒドロキシプロポキシフェニル) -プロパン及びそれらの混合物からなる群から選ばれる請求の範囲第5項に記載の方法。

7. 前記ポリアミドが、数平均分子量が15,000未満の低分子量部分芳香族ポリアミド、数平均分子量が7,000未満の低分子量脂肪族ポリアミド、全芳香族ポリアミド及びそれらの混合物からなる群から選ばれる請求の範囲第1項に記載の方法。

8. 前記ポリアミドが、ポリ (m-キシリレンアジパミド)、ポリ (ヘキサメチレンイソフタルアミド)、ポリ (ヘキサメチレンアジパミド-コ-イソフタルアミド)、ポリ (ヘキサメチレンアジパミド-コ-テレフタルアミド)、ポリ (ヘキサメチレンイソフタルアミド-コ-テレフタルアミド) 及びそれらの混合物からなる群から選ばれる低分子量部分芳香族ポリアミドを含んでなる請求の範囲第7項に記載の方法。

9. 前記低分子量部分芳香族ポリアミドが、数平均分子量が4,000~7,000で、インヘレント粘度が0.3dL/g~0.6dL/gのポリ (m-キシリレンアジパミド) である請求の範囲第8項に記載の方法。

10. 前記ポリアミドが、ポリカプラミド (ナイロン6)、ポリ- ω -アミノヘプタン酸 (ナイロン7)、ポリ- ω -アミノナノン酸 (ナイロン9)、ポリウンデカン-アミド (ナイロン11)、ポリアウリルラクタム (ナイロン12)、ポリエチレン-アジパミド (ナイロン2, 6)、ポリテトラメチレン-アジパミド (ナイロン4, 6)、ポリヘキサメチレン-アジパミド (ナイロン6, 6)、ポリヘキサメチレン-セバカミド (ナイロン6, 10)、ポリヘキサメチレン-ドデカミド (ナイロン6, 12)、ポリオクタメチレン-アジパミド (ナイロン8, 6)、ポリデカメチレン-アジパミド (ナイロン10, 6)、ポリドデカメチレン-アジパミド (ナイロン12, 6) 及びポリドデカメチレン-セバカミド (ナイロン12, 8) からなる群から選ばれる少なくとも1種の低分子量脂肪族ポリアミドからなる請求の範囲第7項に記載の方法。

11. 前記ポリアミドが、ポリ（ヘキサメチレンアジパミド）、ポリ（カプロラクタム）及びそれらの混合物からなる群から選ばれる低分子量脂肪族ポリアミドからなる請求の範囲第7項に記載の方法。

12. 前記ポリアミドが、数平均分子量が3,000～6,000で、インヘレント粘度が0.4～0.9dL/gのポリ（ヘキサメチレンアジパミド）からなる請求の範囲第7項に記載の方法。

13. 少なくとも85モル%のテレフタル酸、2, 6-ナフタレンジカルボン酸またはそれらの混合物からなるジカルボン酸成分、及び少なくとも85モル%のエチレングリコールからの反復単位を含むポリエステル、ならびに融点が該ポリエステルの融点より低い、0.05重量%～2重量%の少なくとも1種のポリアミドからなる、オゾン処理液体充填用の容器であって、該容器中のオゾン処理液体に含まれるアセトアルデヒド量が、該ポリエステルから形成された容器中の非オゾン処理液体に含まれるアセトアルデヒド量より多くない容器。